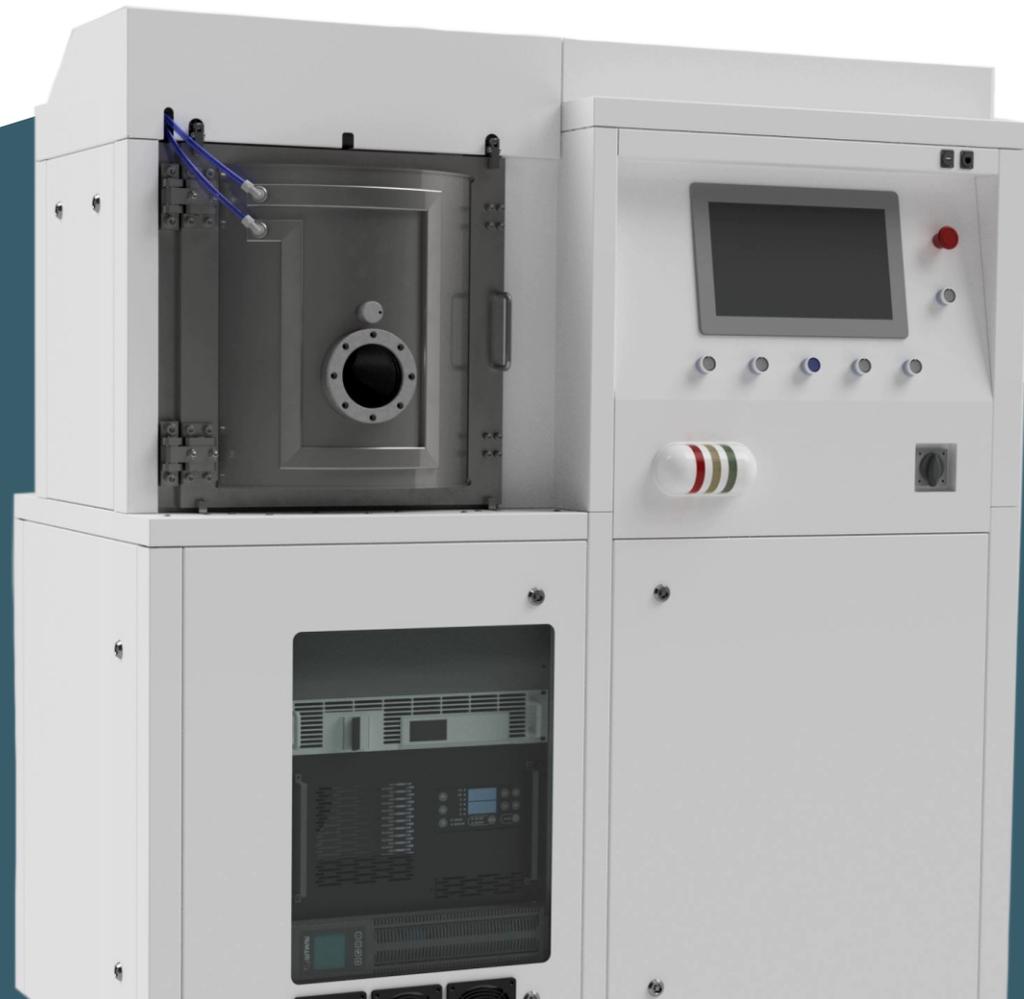




SAVTECH
SOLDERING & VACUUM TECHNOLOGIES



ООО "САВТЭК"

124498, г. Москва, г. Зеленоград,
проезд 4922-й, д. 4, стр.5
(Технопарк "Элма")

+7(495) 642 63 07, info@savtech.ru

savtech.ru

SAVTECH U-RTD - Установка для нанесения тонкопленочных покрытий методом термического испарения.

- Технологическая камера – D-образная из нержавеющей стали. Внутри технологической камеры расположены резистивные испарители с заслонками, прецизионный вращающийся подложкодержатель купольного типа, элементы системы кварцевого контроля процесса нанесения покрытий, система нагрева, система защиты от запыления стенок.
- Испарители имеют общую систему питания и управления и снабжены независимыми заслонками.
- Система управления позволяет осуществлять плавный выход испарителя на режим перед напылением, управление мощностью испарителя со стабилизацией скорости напыления по кварцевому датчику.
- Держатель подложек выполнен в виде съемного купола из нержавеющей стали с отверстиями под установку обрабатываемых изделий. Геометрия держателя оптимизирована для наилучшего результата по равномерности покрытий.
- Привод вращения держателя обеспечивает плавное изменение и высокую стабильность скорости вращения в диапазоне от 5 до 40 об./мин.
- Вакуумная система построена на базе турбомолекулярного и спирального насосов.
- Система управления установкой построена на базе модульного ПЛК SEGNETICS и ПК с графическим интерфейсом, и обеспечивает ручное, полуавтоматическое и автоматическое управление откачкой, нагревом и нанесением покрытия.

Система также обеспечивает:

- визуализацию состояния систем установки;
- возможность управления уровнями доступа (оператор, технолог, наладчик);
- составление рецептов технологических процессов и их выполнение в автоматическом или полуавтоматическом режиме;
- протоколирование хода технологического процесса с архивированием и составлением паспорта проведенного процесса;
- сбор производственной статистики.

Применяемые подложки	InGaAs, InP, Ge
Размер подложек, см²	5
Объем загрузки, шт.	10
Толщина наносимого покрытия, мкм	до 6
Равномерность толщины покрытия, %	5
Скорость вращения подложкодержателя, об/мин	5 - 40
Количество резистивных испарителей, шт.	2
Диаметр рабочей зоны, мм	600
Предельное остаточное давление в камере, Па	5×10^{-4}
Рабочее остаточное давление в камере, Па	7×10^{-4}
Время достижения рабочего давления, мин	30
Форвакуумный насос	Безмасляный, спиральный
Высоковакуумный насос	Турбомолекулярный
Система охлаждения	Водяная
Электропитание	380 В, 50 Гц, 3 ф
Потребляемая мощность, кВт	15
Габаритные размеры, мм	1480x780x1920
Масса, кг	1500